

第11回真空シンポジウム

「成膜技術の新しい展望、展開 ～ウェットもドライもナノスケールで制御～」

聴講者の募集

第11回の真空シンポジウムを下記要領で開催いたします。

現在、PVD、CVD等の成膜技術は、半導体デバイス、各種ディスプレイ等の生産技術として不可欠なものになり、更にその重要性が高まっています。今回は従来のこれら成膜技術の範疇にとらわれず、今後の発展が期待される成膜プロセスを学際的に取り上げました。超薄膜と厚膜、ウェット(液相)プロセスとドライ(気相)プロセス等の対比により、これらの成膜プロセスがどのような可能性があるのか、それぞれの分野でご活躍のリーダにご講演をお願いしました。新しい発想は異分野・異質なところにそのヒントがあるかもしれません。皆様のご参加をお待ちしています。

記

- 開催日時：2010年9月2日(木) 13:00～16:45
- 開催場所：東京ビッグサイト会議棟6階605号
- 主 催：日本真空協会・日本真空工業会
- 参 加 費：日本真空協会会員・日本真空工業会会員 3,000円
(資料代、税込み) 一般 5,000円
学生 1,000円

5. プログラム：

13:00～13:05	開会の挨拶	土岐 和之	日本真空協会 産業部会会長
13:05～13:25	イントロダクトリートーク	岡野 達雄	日本真空協会 会長
13:25～14:25	「酸化物の原子層制御エピタキシーとその集積化による機能開発」	川崎 雅司	東京大学 生産技術研究所 教授
休憩 (15分)			東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 教授
14:40～15:40	「AD (エアロゾルデポジション) 法による常温セラミックスコーティング」	明渡 純	産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 主幹研究員
15:40～16:40	「ウェットプロセスによる機能薄膜・表面形成と応用」	本間 敬之	早稲田大学 先進理工学部応用化学科 教授
16:40～16:45	閉会の挨拶		

- 募集人員：120名
- 参加申込受付：～8月30日(月)
- 申し込み先：(株)シー・エヌ・ティ(VACUUM2010ー真空展事務局)
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-2 大森ビル
電話：03-5297-8855 FAX：03-5294-0909
<http://www.cnt-inc.co.jp/vacuum/symposium.html>

真空シンポジウム事務局 行 (FAX:03-5294-0909)

2010年 月 日

第11回 真空シンポジウム参加申込書

参 加 費	☐ 日本真空協会会員 (¥3,000) ☐ 日本真空工業会会員 (¥3,000) ☐ 一般 (¥5,000) ☐ 学生 (¥1,000) ※チェックがない場合は一般扱いとなります。		
会 社 ・ 機 関 名			
所 在 地	〒 ※請求書、受講券をお送りします。		
氏 名	所属	TEL :	
		FAX :	
E-mailアドレス			